

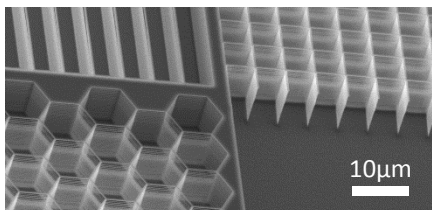
描画

超高精度電子ビーム描画装置

ELIONIX社製 ELS-7500EX

仕様

光源	電子ビーム
描画方法	直接描画
描画対象	6インチまで対応可能
描画精度	最小線幅10nm
継ぎ精度	40nm
描画所要時間	・線幅1 μ mで2インチウエハに描画;5~6時間 ・線幅10nmで2インチウエハに描画;4日間



超微細描画

シリコン、ガラス等の平板な基板上に専用の樹脂を塗布し、直接電子ビームで極微細(最小10nm)パターンを描画します。

ご希望により、パターン加工した樹脂をマスクとして、材料(シリコン、ガラス等)の加工(エッチング)も行えます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム・香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp